

# Chirped 回折格子를 利用한 集積形 波長分割 多重化器 製作 및 特性 測定

\* 서 만수, 송재원

경북대학교 전자공학과

Fabrication and characterization of integrated optic wavelength demultiplexer using a chirped grating

\* Man Soo Seo and Jae Won Song

Department of Electronics, Kyungpook National University

## Abstract

Optical waveguide was fabricated in the soda lime glass substrate using rapid thermal method. A chirped grating having period variation of  $0.41 - 0.51\mu m$  on this waveguide for WDM was made. And then, arranging input and output optical fiber, wavelength division multiplexer with 5 channels in short wavelength region was realized. Experiment result of this WDM showed that wavelength spacing, 3 dB bandwidth, insertion loss and crosstalk were 5nm, 40dB, 40dB and less than -10dB, respectively.

## I. 서론

파장분할 다중화를 위해 파장에 따라 각각 다른 채널로 분파, 합파시키는 분파기, 합파기가 필요하다. 이 분파기, 합파기를 구성하는 각분산 소자로 프리즘, 이색거울, 회절거울 등이 이용되는데 그 중에서 회절거울이 분산 특성이 좋다. 회절거울을 만드는 방법에는 여러가지가 있으나 홀로그램 회절거울은 만드는 장치가 간단하고, 서브마이크론 이하의 제작이 가능한 장점이 있다.<sup>1)</sup> 이 회절거울을 이용한 분파기, 합파기의 구성은 벌크형과 집적광학형이 있는데 전자는 광섬유와 회절거울을 결합하기 위한 렌즈가 필요하고, 크기가 크며, 구조가 복잡한 단점이 있다. 이러한 단점을 보완하기 위하여 회절거울과 평면도파로를 조합한 분파기<sup>2)</sup>나 평면 도파로위에 직접 거울을 제작하는 집적광학형 소자<sup>3,4)</sup>가 있다.

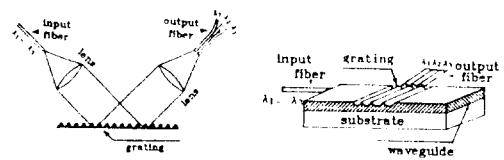
그리서 본 논문에서는 크기와 구조에서 가장 작고 간단한 집적광학형 파장분할 다중화기를 제작하고 그 특성을 측정하였다. 먼저 유리 기판 위에 K-Na 이온교환 방법을 이용하여 유리 도파로를 제작하였다. 다음 그 위에 5mm에 걸쳐 거울 주기가  $0.41 - 0.51\mu m$ 로 선형적으로 변하는 회절거울(Chirped Grating)을 홀로그램 방법으로 제작하고,

입출력 광섬유를 배치하여 광분파기, 합파기를 완성하였다. 사용 파장 영역으로는 광통신의 단파장 영역인  $0.8 - 0.9\mu m$ 을 선택하였고, 입출력 광섬유로 크기가  $125/50\mu m$ (외경/내경)인 경사형 광섬유를 사용했으며, 사용체널은 5채널로 하였다. 또한 광스펙트럼 분석기와 백색광원을 이용하여 집적형 파장분할 다중화기로 실현된 이 소자의 분파 특성을 측정하였으며, 파장이  $0.85\mu m$ 인 레이저 다이오드(LD) 광원을 이용하여 삽입 손실을 측정하였다.

## II. 본론

### 1. 파장 분할 다중화기

광섬유 통신 시스템의 정보 전송 능력을 증가시키기 위한 방법으로 파장분할 다중화(Wavelength Division Multiplexing : WDM)법이 연구되어 왔다. 이 방법은 송신측에서, 각각 다른 파장의 빛에 여러가지 정보를 실어서 합파기를 통하여 하나의 광섬유로 전송하고 분파기를 통하여 파장별로 분리하여 수신측에서 원래의 정보를 수신하는 방법으로 이 합파기, 분파기를 구성하는 소자로 여러가지가 있지만 그 중에서 회절거울이 많이 이용되고 있다. 이 회절거울의 구성형태는 크게 벌크형(bulk type)형과 집적 광학형(integrated optics type)으로 나눌 수 있는데 그림 1의 (a)에서처럼 벌크형은 크기가 크고 구성이 복잡한 단점이 있는 반면 집적 광학형은 그림 1의 (b)에서 보는 바와 같이 벌크형의 이러한 단점을 보완 할 수가 있다. 또한 이 집적 광학형 소자의 용용으로 파장분할



(a) bulk type      (b) integrated optics type  
Fig. 1. The configuration of demultiplexer.

다중화기 뿐만 아니라 회절각자 맨즈, 격자 결합기, 모드 변환기 등 그 용도 범위가 넓어 이 소자에 대한 연구<sup>5,6,7)</sup>가 많이 되고 있다.

## 2. 회절 격자 설계

주기가 선형적으로 변하는 격자인 Chirped Grating에 여러 가지 파장 성분을 갖는 빛이 그림 2와 같이  $\theta$ 의 각으로 입사하게 되면 각 파장 성분마다 브리그 조건( $\Delta n = \lambda_n / 2N \cos \theta$ ; N: 유효 굽률)을 만족하는 영역이 조금씩 달라 지면서  $20^\circ$ 의 각으로 편향될 것이다. 따라서 편향된 이 격자의 꼭 부문에 출력 광섬유를 경유하면 파장 분할 기로 사용 할 수 있다. 이때 각 파장 영역마다 최대의 효율을 얻을수 있도록 설계하기 위해 가장 먼저 고려해야 할 것이 사용 파장 영역인데 본 논문에서는 광통신의 단

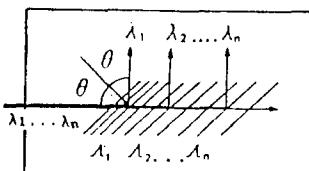


Fig. 2. Demultiplexing in a dielectric waveguide with chirped grating.

파장 영역인  $0.8 - 0.9 \mu\text{m}$ 를 선택하였다. 그 다음 격자의 입사각  $\theta$ 를 결정해야 하는데  $50^\circ$ 로 하였으며 이 두 조건으로부터 브리그 법칙을 적용하여 회절각자 주기를 구하면 원하는 파장 영역에서 효율이 좋은 분파기를 설계할 수 있다. 분파기를 위한 흘로그램 회절각자를 설계해야 하는데 사용중심 파장을  $0.85 \mu\text{m}$ 로 하였다. 이 파장에 적합한 격자 중심부분의 주기는 브리그 법칙으로부터  $0.44 \mu\text{m}$ 이었다. 이러한 구조를 갖는 Chirped Grating을 위한 흘로그램 노광장치의 기하학적 구조가 그림 3이다. 노광을 위한 광원으로는 파장이  $4579 \text{\AA}$ 인 Ar-ion laser를 이용하였으며, cylindrical 맨즈의 F수는 2, 기판에 대한 입사

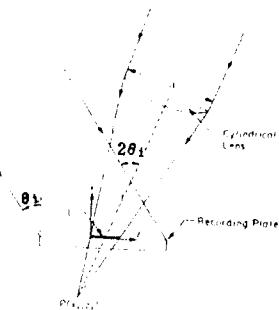


Fig. 3 Geometry for the fabrication of chirped grating.

각  $\theta_i = 30^\circ$ , 기판에 기록되는 1.0 cm<sup>2</sup>중에서 실험에 적합

한 격자 길이 5mm만 마스크를 써워 선택하였다. 이 회절각자의 주기가 선형적으로 변화하는 것은 원쪽에서 오는 평행광선과 오른쪽에서 접속맨즈를 통해오는 광선과의 교차각의 차이 때문에 주기가 변하는 것으로  $f$ ,  $L$ ,  $d$ ,  $\theta_i$ 와 주기  $\Lambda(Z)$ 와의 관계식<sup>8)</sup>은 다음과 같다.

$$x_r = \frac{-L \cos(\phi + \theta_i)}{\sin 2\phi} \cos(\phi - \theta_i), \text{ and}$$

$$z_r = \frac{L \cos(\phi + \theta_i)}{\sin 2\phi} \sin(\phi - \theta_i),$$

$$\text{where } \phi = \tan^{-1}\left(\frac{d}{2f}\right)$$

$$\Lambda(Z) = \frac{\lambda}{\sin \theta_i + \frac{Z - z_r}{\sqrt{(Z - z_r)^2 + x_r^2}}} \quad (1)$$

식(1)은 기록판에 기록되는 격자길이에 따른 주기와의 관계를 나타낸 것으로, 여기서  $x_r$ ,  $z_r$ 는 cylindrical lens의 초점위치를 나타낸다. 그림 4는 본 실험에서 제작될 격자길이 1cm에 걸쳐 격자 주기와의 관계를 식(1)으로부터 구한 결과인데 격자길이에 따라 주기가 선형적으로 변하는 것을 알 수 있으며, 실제 이용될 부분은 2~7mm이

period

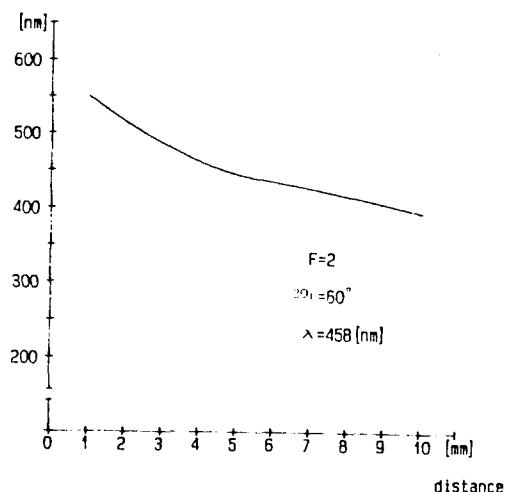


Fig. 4. Period variation as the grating length. The angle  $\theta_i$  has a value of  $60^\circ$  and the range of period variation is from 0.38 to 0.59  $\mu\text{m}$  about 1.0 cm.

다. 그림 5는 실제 제작될 격자길이 5mm에서 격자 주기와 사용 파장과의 관계를 나타낸 그레프로 주기의 변화에 대해 파장의 변화가 큰 것을 알 수 있는데 이 파장변화가 너무 크거나 적으면 측정하기에 불편하므로 실험에 적합하도록 여러가지 조건을 잘 고려해야 한다.

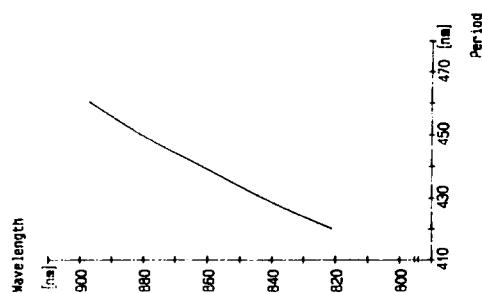


Fig. 5. Relation between the wavelength and period.  
Bragg's law  $\Lambda = \lambda / 2N \cos \theta$ ,  $\theta = 50^\circ$ ,  $N = 1.52$

### 3. 회절격자 제작

광분사기, 합파기를 위한 흘로그램 회절격자를 제작하는 과정은 그림 6과 같다.

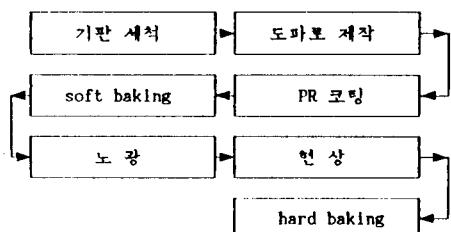


Fig. 6. Flow chart of the holographic grating fabrication.

먼저 유리 기판을 세척해야 하는데 세척 과정은 표 1과 같다. 위의 세척과정을 행한후  $440^\circ\text{C}$ 에서 20분간 금열 방식에 의한 K-Na 이온 교환 도파로를 제작한 후 두께가

Table 1. substrate cleaning procedure

Sequence	Chemicals	Time	Remark
1	Alconox cleaning		
2	D. I. water rinse	5 min.	
3	$3\text{H}_2\text{SO}_4 : 1\text{H}_2\text{O}$	5 min.	$100^\circ\text{C}$
4	D. I. water rinse	5 min.	
5	$\text{N}_2$ blowing		wafer drying

$3000\text{\AA}$  되게 포지티브 PR인 AZ-1350B를  $7500\text{rpm}$ 으로 30초 동안 스픬 코팅한 다음  $80^\circ\text{C}$  오븐에서 30분간 soft baking한다. 다음으로 회절격자를 위한 흘로그램 사진술에 의한 노광으로 노출 장치에 대한 개략도<sup>9)</sup>는 그림 7과 같다. 포지 PR을 감광시키기 위하여 노출광원으로 Ar-ion laser(파장  $4579\text{\AA}$ )를 사용했으며 입사빔의 세기 가  $1.38\text{ mW}$ 일때 노출 시간을 30초로 하였다. 현상액은 포

지 PR 전용 용액인 AZ-351과 DIW를 1:1로 섞어서 30초 동안 현상하였으며 현상하고 난 다음 PR의 건고성을 위해  $135^\circ\text{C}$ 에서 2분간 hard baking을 실시하였다. 이렇게 제

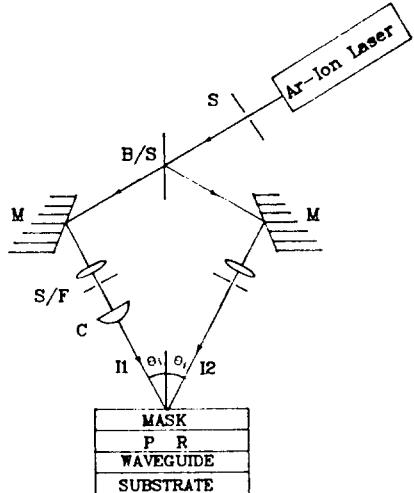
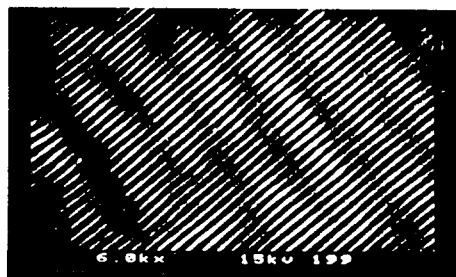
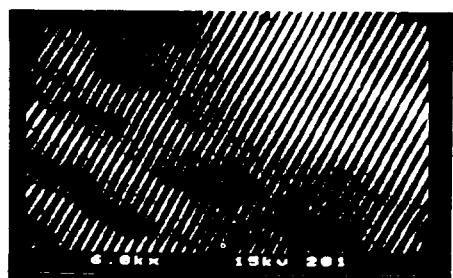


Fig. 7. Schematic of the holographic lithography.  
S:shutter, B/S:beam splitter, M:mirror,  
 $\theta$ :incident angle, S/F:spatial filter,  
C:cylindricia lens.

작된 회절격자를 전자현미경(SEM)으로 찍은 사진이 그림 8인데 6000배로 확대한 것이다. 사진의 하단부분에 있는 “—” 표시는  $1\mu\text{m}$ 을 나타내며 이 것으로 부터 주기를 구해보면 (a)는 주기가  $0.46\mu\text{m}$  (b)는 주기가  $0.5\mu\text{m}$ 로 설계했던대로 chirped grating이 잘 만들어 졌다는 것을 알 수 있다.



(a) plane (X6000), period :  $0.46\mu\text{m}$



(b) plane (X6000), period :  $0.5\mu\text{m}$

Fig. 8. SEM photographs of the fabricated chirped grating.

### III. 실험 및 결과

이와 같이 유리도파로 위에 흐로그램 회절각자를 만들고 난 뒤, 입출력 광섬유를 배치하여 광 분파기를 완성 하였으며 완성된 분파기의 분파 특성을 측정하기 위해 그림 9와 같이 구성하였다. 입출력 광섬유로는 크기가 125/50  $\mu\text{m}$ (외경/내경)이고 NA가 0.21인 경사형 광섬유를 사용하였다. 출력 광섬유의 갯수는 5개이다. 즉 5채널 광 분파기로 동작된다. 광원으로는 여러가지 파장 성분이 고르게 분포되어 있는 백색광원을 이용하였고 측정에 사용된 파장영역은 광통신의 단파장 영역인  $0.8 \sim 0.9 \mu\text{m}$ 를 선택하였다. 백색광원으로부터 입력 광섬유를 통해 나오는 빛을 도파로 꿀에 잘 결합 시킨다. 도파로를 지나 회절각자를 만나면 브리그 조건을 만족하는 영역이 조금씩 달라지면서 그림 2와 같이 편향된다. 이때 편향된 도파로 꿀 부분에 출력 광섬유 5개를 정렬한 다음 광스펙트럼 분석

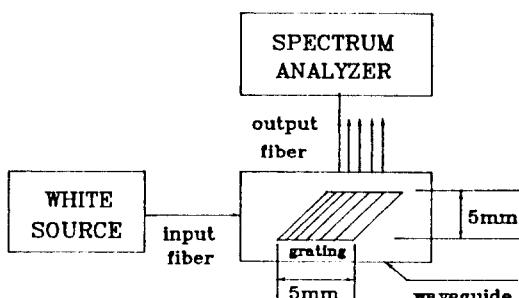


Fig. 9. Schematic of demultiplexer characteristics experiment.

기(Anritsu사 model MS96A)로 분석하여 그림 10과 같은 본파 특성을 얻었다. 이 결과를 보면 채널당 파장 간격은

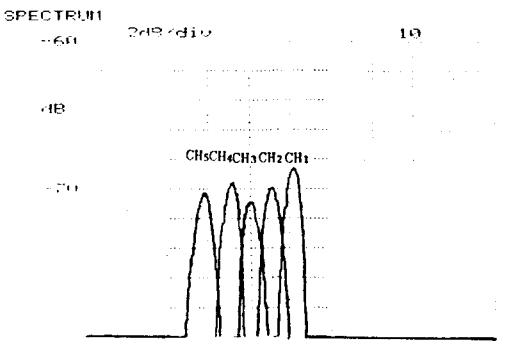


Fig. 10. Demultiplexer branching characteristics.

약 5 nm 정도로 이론치와 비슷한 값이다. 3dB 대역폭은 4nm 정도이며, 누화는 -10dB 이하 임을 알 수 있는데 삽입 손실만 줄일수 있다면 누화는 충분히 개선되리라 본다. 또한 삽입 손실을 측정하기 위해 백색 광원대신 파장이 0.85/ $\mu\text{m}$ 인 레이저 다이오드(LD)를 이용하여 측정한 결과 약 40dB 였다. 이상을 바탕으로 실험 결과를 요약 하여 표 2에 나타내었다.

Table 2. Demultiplexer measurement results.

channel number	5 channel
wavelength spacing	5 nm
3 dB bandwidth	4 nm
crosstalk	-10 dB
insertion loss	40 dB

### IV. 결론

소다 유리 기판에 금연 방식으로 광 도파로를 만들고, 그 위에 폭 5mm에 걸쳐 주기가  $0.41\mu\text{m}$ 에서  $0.51\mu\text{m}$ 로 선형적으로 변하는 회절 각자를 제작하고, 입출력 광섬유를 배치하여 단파장용 5채널 광분할 다중화기를 완성하였다. 이 다중화기의 각종 특성을 측정하였으며 그 결과 채널당 파장 간격이 5nm, 3dB 대역폭이 4nm, 삽입 손실이 40dB 였다. 개선점으로는, 만약 ion-beam etching machine을 사용하여 직접 유리 도파로를 에칭하여 회절각자를 제작한다면 더 좋은 본파특성이 기대된다.

### 참고문헌

1. Koh-ichi Aoyama and Jun-Ichiro Minowa, "Optical demultiplexer for a wavelength division multiplexing system," Appl. Opt., Vol. 18, pp. 1253-1258, 1979.
2. Toshiaki Kita and Tatsuo Harada, "Use of aberration corrected concave gratings in optical demultiplexers," Appl. Opt., Vol. 22, pp. 819-825, 1983.
3. Toshiaki suhara, Juha viljanen, and Matti Lepplihalme, "Integrated-optic wavelength multi- and demultiplexers using a chirped grating and an ion-exchanged waveguide," Appl. Opt., Vol. 21, pp. 2195-2198, 1982.
4. A. C. Livanos, A. Katzir, A. Yariv, and C. S. Hong, "Chirped grating demultiplexers in dielectric waveguides," Appl. Phys. Lett., Vol. 30, pp.

- 519-521, 1977.
5. S. K. Yao and D. E. Thompson, "Chipped-grating lens for guided-wave optics," *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 33, pp. 635- 637, 1978.
6. Gen-ichi Hatakoshi and Shun-ichi Tanaka, "Grating lenses for integrated optics," *Opt. Lett.*, Vol. 2, pp. 142-144, 1978.
7. Fukuzawa and M. Nakamura, "Mode coupling in thin film chirped gratings," *Opt. Lett.*, Vol. 4, pp. 343-345, 1979
8. A. Katzir, A. C. Livannos, J. B. Sheellan, and A. Yariv, "Chirped Gratings in intergrated optics," *IEEE J. Quantum Electronics.*, QE-13, pp. 296-304, 1977.
9. W. W. Ng, C. S. Hong, and A. Yariv, "Holographic interference graphy for integrated optics," *IEEE Trans. Electron Devices*, Vol. ED-25, PP. 1193-1200, 1978.